PRESSEMELDUNG



SSL China: AIXTRON präsentiert auf Leitmesse aktuelles Technologieportfolio für die Halbleiterproduktion

Innovative Anlagentechnologie für die Herstellung von LEDs und Leistungselektronik sowie zur OLED- und Graphen-Produktion im Fokus

Herzogenrath, 30. Oktober 2015 – AIXTRON SE (FSE: AIXA; NASDAQ: AIXG), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, präsentiert im Rahmen des Seminars "Innovative MOCVD Solutions for Ground-Breaking Business Ideas" zentrale Technologie-Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Halbleiterindustrie. Dabei stehen vor allem die MOCVD-basierten Lösungen für die Herstellung von LEDs und Leistungselektronik sowie die Anlagentechnologie für die Produktion von OLEDs und Graphen im Mittelpunkt.

AIXTRON informiert unter anderem über die inzwischen von Kunden bestätigten Eigenschaften und Vorteile der AIX R6 Close Coupled Showerhead®-Anlage, die für die großvolumige LED-Produktion entwickelt wurde. Nach ausführlichen Testzyklen bei verschiedenen Kunden, stellt AIXTRON die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit sowie Belege für die Effizienz- und Kostenvorteile der Anlage vor.

Die Herstellung von LEDs auf 200 mm Siliziumsubstraten wie auch das Marktpotenzial von tief ultravioletten LEDs bilden weitere Schwerpunkte des Seminars. Beide Produkte werden aus Sicht von AIXTRON in den kommenden Jahren zunehmend das Interesse von Herstellern auf sich ziehen und aufgrund der fortschreitenden Technologieentwicklung in immer mehr Anwendungen zum Einsatz kommen. AIXTRON stellt hierfür schon heute die notwendigen Forschungs- und Produktionsanlagen zur Verfügung und gibt in diesem Seminar anhand eines Erfahrungsberichts von Dr. Jun-Youn Kim (Samsung Electronics) unter anderem detailliert Auskunft über die Leistungsfähigkeit der AIX G5+ zur Herstellung von LEDs auf 200 mm Siliziumsubstraten.

Auch die Leistungselektronik gewinnt in der Halbleiterindustrie aufgrund vielfacher Anwendungsmöglichkeiten zunehmend an Bedeutung. Informationen zu den aktuellen Produktionstechnologien von AIXTRON sowie ein Erfahrungsbericht von Dr. Kai Cheng (Enkris Semiconductors) zur Herstellung von Leistungselektronikbauteilen auf Basis von Galliumnitrid auf Silizium (GaN-on-Si) geben Besuchern des AIXTRON-Seminars einen exzellenten Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand.

Erstmals stellt AIXTRON im Rahmen der diesjährigen SSL China auch den aktuellen Stand seiner Aktivitäten im Bereich der OLED- und Graphenproduktion vor. Als Markt- und Technologieführer kann AIXTRON auf eine exzellente Leistungsbilanz verweisen.

PRESSEMELDUNG



Besuchen Sie im Rahmen der SSL China das Seminar "Innovative MOCVD Solutions for Ground-Breaking Business Ideas" und informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen in der Anlagentechnologie:

2. November 2015, 13:30-17.15 Uhr

Shenzhen Convention & Exhibition Center 6. Etage, Osmanthus Hall

Fuhua 3rd Road, Futian District, Shenzhen, 518048 China

Die Anmeldung für das Seminar erfolgt über das Veranstaltungsbüro der SSL China:

Liu Hui (T: +86-10 82387600-509, E: liuh@china-led.net)

Zhang Yaqin (T: (86-10)82387600-655, E: <u>zhangyq@china-led.net</u>)

Weitere Einzelheiten zur Veranstaltung sowie die Agenda des Seminars finden Sie unter dem Link http://www.sslchina.org/Schedule/Details/p501 oder unter www.aixtron.com.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Siliziumoder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®, Gas Foil Rotation®, Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6; NASDAQ: AIXG, ISIN US0096061041) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

.-----

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

PRESSEMELDUNG



Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.